Установка плазмохимического осаждения Vision 410 PECVD

Установка плазмохимического осаждения Vision 410 PECVD

Image not found or type unknown

Производитель:	Цена:
Plasma-Therm	Цена по запросу

Описание

Установка плазмохимического осаждения Vision 410 PECVD компании Plasma-Therm— это компактная, надежная, экономически эффективная и простая в эксплуатации и обслуживании установка плазмостимулированного осаждения из газовой фазы для R&D-лабораторий, мелкосерийных, пилотных и серийных производств.

Установка Vision 410 PECVD позволяет осаждать следующие материалы:

- Диэлектрики: SiO2, SiNx, SiOxNy;
- Полупроводниковые материалы: SiC, a-Si.

Ключевые преимущества установки Vision 410 PECVD:

- Большая область загрузки — круглый стол диаметром 406 мм, который позволяет обрабатывать подложки разных форм и размеров.
- Равномерность осаждаемого покрытия по толщине и воспроизводимость результатов от пластины к пластине — лучше ±2%.
- В комплекте с установкой поставляется библиотека стандартных технологических процессов, которые гарантируются производителем.
- Программное обеспечение позволяет записывать параметры процессов для дальнейшего анализа.
- История аварийный сообщений, контроль рецептов в процессе работы — вывод данных о процессе на дисплей в режиме реального времени.
- Многоуровневый доступ пользователей.
- Возможность удаленного управления и контроля состояния системы.
- Наличие различных вариантов системы отслеживания окончания процесса (OES, OEI).
- Простой, интуитивно понятный интерфейс.
- Простота использования и обслуживания.
- Малая занимаемая площадь

- Возможность установки через стену чистого производственного помещения.

Основные опции

- Система отслеживания окончания процесса:
  - Оптическая эмиссионная спектроскопия (OES)
  - Оптическая эмиссионная интерферометрия (OEI)
- Дополнительные газовые линии (до 8 в сумме),
- Специальные держатели образцов,
- Пакет для установки через стенку ЧПП,
- Расширенная гарантия производителя

Основные технические характеристики установки Vision 410 PECVD

Размер электрода	16″ (406 мм) в диаметре
Температура электрода	+80...350 °C
Материал электрода	Алюминий
Тип плазмы	Емкостная
ВЧ-генератор	600 Вт, 13,56 МГц. Опционально 1200 Вт, 13,56 МГц
Вакуумная камера	Изготовлена из цельного блока алюминия
Откачная система	Форвакуумный насос 600 м3/ч, безмасляный
Уровень вакуума	<10-6 торр
Контроль давления процесса	Автоматический
Газовые линии с цифровыми РРГ	5 линий (стандартно). Опционально до 8 линий
Система контроля, ПО	Cortex на базе Windows 7
Электропитание	380 В, 50 Гц, 3 фазы
Габариты установки (Ш×Г×В)	667×1146×1880 мм
Сертификация	CE, SEMI-2, S8
Удаленный мониторинг состояния системы	SECS/GEM